



即时发表

经办代理:

David Moreno (大卫 穆锐农)

Open Sky Communications

电话: +1-415-519-3915

电邮: dmoreno@openskypr.com

EBEAM INITIATIVE 调查显示光罩市场成长前景将持续乐观

第十届业界精英调查结果将在 SPIE 光罩技术会议上的线上活动中公布

圣荷西, 加州, 美国, 二零二一年九月二十八日—eBeam Initiative, 一个致力于推动和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体, 今天宣布第十届年度 eBeam Initiative 业界精英调查顺利完成。任职于横跨整个半导体生态系统不同公司的 44 个业界精英参加了今年的调查; 他们代表了整个半导体生态系统的公司—包括光罩, 电子设计自动化软件 (EDA), 芯片设计, 仪器设备, 材料, 制造和研发等领域。

业界精英调查百分之七十二的参与者预计 2021 年光罩市场总额与 2020 年相比会有所增加, 而百分之七十四的回答相信 EUV 会驱动光罩增长。问卷回答者列出 EUV 依然是购买多电子束光罩刻写机的头号动机。百分之九十的回答相信多电子束光罩刻写机市场会在今后三年持续增长, 同时, 要购买激光光罩刻写机和变形电子束(VSB)光罩刻写机的意向也比去年的调查有所增加。制造曲线图形光罩的信心也比去年高, 百分之七十一的回答表示先进光罩厂可以至少生产数量有限的曲线图形先进光罩。

业界精英调查结果的完整报告将在今晚的 eBeam Initiative's 网络会议上由专家小组对其讲解讨论。调查结果的完整报告可以在会后由此链接下载 www.ebeam.org。

业界精英调查其它要点有 (调查在 2021 年 7 月完成) :

- 百分之九十五的回答相信逆向微影技术 (ILT) 今天正在用于芯片制造。
- 预计曲线图形技术用在 193i 光罩的数量比用在 EUV 光罩的数量要多。
- 光罩检测 (mask inspection) 和光罩生产设施(infrastructure)被列入制造曲线图形光罩中的两大担忧。
- 但是, 只有百分之四的回答认为以上对曲线图形的担忧是难以逾越的。



EBEAM INITIATIVE PUBLISHES RESULTS OF 10TH ANNUAL LUMINARIES SURVEY.....Page 2 of 2

“十年来，每年 eBeam Initiative 主办的业界精英调查为我们提供了一个了解业界有影响力人士怎样看待半导体工业的主要趋势的宝贵视角，” eBeam Initiative 的主办管理公司 D2S 的 CEO 藤村 (Aki Fujimura) 表示，“去年的调查结果显示，即使在新冠疫情 (COVID-19) 影响下，大家对光罩市场的前景预测还是正面的，今年调查结果则更加乐观。在调查中尤其值得注意的是业界精英对曲线光罩制造的高度信心。这种信心也反应在今年 SPIE 光罩技术会议上，有史以来第一次设立了一个以曲线光罩为主题的议程，显示对曲线光罩图形在先进半导体制造中的重要性越来越多的肯定。”

关于 eBeam Initiative (电子束倡议团)

eBeam Initiative 是一个致力于推广和倡导电子束技术在半导体制造全新应用的团体；为有关电子束技术的教育和促进活动提供相应的论坛。eBeam Initiative 的目标是增加电子束技术应用在半导体制造各领域中的投资；降低电子束技术应用的障碍，能够使更多集成电路设计完成，并且更快投进市场成为可能。会员公司，涵盖整个半导体生态系统，包括：aBeam Technologies; Advantest; Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Aselta Nanographics; ASML; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; Fraunhofer IPMS; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GlobalFoundries (GF); Grenon Consulting; Hitachi High-Tech Corporation; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KIOXIA; KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photonics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; TASMITE; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Toppan Inc.; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS. eBeam Initiative 面向和欢迎所有电子工业的公司和协会加盟。细节请查看 www.ebeam.org.

###